

# Cesto De Limpeza De Wafers Ptfе 4 Polegadas Rack De Gravação Resistente A Ácidos E Alcalis Portador De Máscaras Personalizado

Número do item: PL-CP90



## introdução

Cestos de gravação em PTFE de engenharia de precisão, projetados para limpeza de wafers semicondutores e processamento químico. Estes racks de limpeza resistentes a ácidos e de alta pureza garantem contaminação zero em ambientes de laboratórios exigentes. Totalmente personalizáveis para atender dimensões específicas de máscaras industriais e wafers para aplicações avançadas de fabricação e pesquisa.

[Saiba mais](#)

Aplicação	Descrição	Principal Benefício
Gravação Úmida de Semicondutores	Submersão de wafers de silício em soluções ácidas para remover filmes finos ou limpar superfícies.	Resistência total ao HF e outros agentes de gravação agressivos garante zero degradação do material.
Limpeza de Fotomáscaras	Transporte de máscaras de quartzo sensíveis através de ciclos especializados de lavagem química e enxágue.	O contato de material de baixo impacto previne danos à superfície em padrões intrincados de máscaras.
Fabricação de Células Solares	Processamento de wafers fotovoltaicos durante as fases de texturização e limpeza de dopagem.	Alta capacidade de throughput e estabilidade química melhoram a eficiência geral de fabricação.
Processamento MEMS	Manuseio de sistemas microeletromecânicos através de diversos ambientes de gravação química.	Ranhuras de precisão garantem que componentes pequenos e frágeis sejam seguramente fixados durante a agitação.
Análise de Metais Traço	Limpeza de vidraria e recipientes em banhos de ácido de alta pureza antes de testes analíticos.	Elimina a contaminação cruzada fornecendo um ambiente de limpeza livre de metais.
Pesquisa em Nanotecnologia	Gerenciamento de substratos experimentais em novas soluções químicas e ambientes reativos.	Versatilidade em temperatura e compatibilidade química suporta diversos protocolos de pesquisa.

Recurso	Detalhes da Especificação para PL-CP90
Número do Modelo	PL-CP90
Construção do Material	PTFE de Alta Pureza (Politetrafluoretileno)
Compatibilidade de Tamanho de Wafer	4 polegadas (Padrão) / Dimensões Totalmente Personalizáveis
Configuração de Ranhuras	Número personalizável de ranhuras e espaçamento de passo
Resistência Química	Resistência universal a ácidos, alcalis e solventes
Faixa de Temperatura de Operação	-200°C a +260°C
Acabamento Superficial	Usinado CNC de Precisão / Rugosidade Superficial Ultra Baixa
Design da Alça	Estilos destacáveis ou fixos disponíveis (Personalizável)

Aplicação	Descrição	Principal Benefício
Recurso	Detalhes da Especificação para PL-CP90	
Design de Drenagem	Geometria de estrutura aberta de alto fluxo	
Método de Fabricação	Fabricação CNC personalizada de ponta a ponta	
Tipo de Pedido	Produtos personalizados com base nas especificações do cliente	